

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成19年8月16日(2007.8.16)

【公表番号】特表2007-505810(P2007-505810A)

【公表日】平成19年3月15日(2007.3.15)

【年通号数】公開・登録公報2007-010

【出願番号】特願2006-526656(P2006-526656)

【国際特許分類】

<b>C 0 3 C</b>	<b>17/36</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>H 0 5 K</b>	<b>9/00</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>G 0 9 F</b>	<b>9/00</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>B 3 2 B</b>	<b>17/06</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>B 3 2 B</b>	<b>15/04</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>B 3 2 B</b>	<b>9/00</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>H 0 1 J</b>	<b>11/02</b>	<b>(2006.01)</b>

【F I】

C 0 3 C	17/36	
H 0 5 K	9/00	V
G 0 9 F	9/00	3 0 9 A
G 0 9 F	9/00	3 1 3
B 3 2 B	17/06	
B 3 2 B	15/04	B
B 3 2 B	9/00	A
H 0 1 J	11/02	E

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月14日(2007.6.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

3つの銀層(Ag<sub>1</sub>, Ag<sub>2</sub>, Ag<sub>3</sub>)を包含し、かつ二酸化チタン層(21)、金属酸化物層(22)、銀層(Ag<sub>1</sub>, Ag<sub>2</sub>, Ag<sub>3</sub>)の1つ及び被覆層(23)を基板上に交互に含んで成る薄膜多重層(20)が備わった透明基板において、

金属酸化物が酸化亜鉛であること；

被覆層(23)が犠牲金属であること；及び

少なくとも1つの金属酸化物を含む反射防止層(24)が、基板から最も遠く離れた銀層(Ag<sub>3</sub>)のための被覆層(23)上に被着されていること、  
を特徴とする透明基板。

【請求項2】

銀層(Ag<sub>1</sub>, Ag<sub>2</sub>, Ag<sub>3</sub>)の各々の厚みが13nm～19nmの間であることを特徴とする請求項1に記載の基板。

【請求項3】

それぞれの層(Ag<sub>1</sub>, Ag<sub>2</sub>, Ag<sub>3</sub>)の厚み(eAg<sub>1</sub>, eAg<sub>2</sub>, eAg<sub>3</sub>)が同一であるか、さもなければ、0.8～1.2の間の比率で変動し、eAg<sub>1</sub>=eAg<sub>3</sub>=eAg<sub>2</sub>となるようなものであることを特徴とする請求項2に記載の基板。

**【請求項4】**

基板に最も近い銀層( $A g_1$ )のための副層としての二酸化チタン層(21)が、10~20nmの厚みを有し、その他の2つの銀層( $A g_2$ ,  $A g_3$ )のための副層としての酸化チタン層(21)が、35~55nmの厚みを有することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の基板。

**【請求項5】**

酸化亜鉛層(22)が15nmより大きい厚みを有することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の基板。

**【請求項6】**

犠牲金属層(23)が、ニオブ(Nb)、チタン(Ti)又はジルコニウム(Zr)からなることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の基板。

**【請求項7】**

犠牲金属層(23)が、2nmを超えない厚みを有することを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の基板。

**【請求項8】**

反射防止層(24)が、25~50nmの厚みを有することを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の基板。

**【請求項9】**

反射防止層(24)が、15~35nmの厚みを有する少なくとも1つの二酸化チタン層を内含することを特徴とする請求項8に記載の基板。

**【請求項10】**

反射防止層(24)が、二酸化チタン層及びこの二酸化チタン層上に被着させられ5~15nmの厚みを有する金属酸化物のもう1つの層を内含することを特徴とする請求項8又は9のいずれかに記載の基板。

**【請求項11】**

反射防止層(24)の金属酸化物層が、酸化錫(SnO<sub>2</sub>)又は窒化珪素(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)であることを特徴とする請求項10に記載の基板。

**【請求項12】**

1 / を超えない表面抵抗を有することを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の基板。

**【請求項13】**

強化ガラス又は非強化ガラスから作られているか又はプラスチックから作られていることを特徴とする請求項1~12のいずれか1項に記載の基板。

**【請求項14】**

下記のような光学特性：

45~55%の間の光透過率T<sub>L</sub>；

透過における10%未満の純度；

5%未満の光反射率R<sub>L</sub>；

20%未満の純度での反射における主として紫・青の色；

透過における主として青の色、

を有することを特徴とする請求項1~13のいずれか1項に記載の基板を含む電磁遮蔽フィルタ。

**【請求項15】**

請求項1~14のいずれか1項に記載の少なくとも1つの基板又はフィルタをその前面に内蔵するプラズマディスプレイタイプの表示スクリーン。